文部科学大臣賞

スローライトブラッグ反射鏡導波路を用いた ビーム掃引デバイス

~世界最高解像度を誇る革新的な非機械式光ビーム掃引技術の開拓~

東京工業大学 総合理工学研究科 物理電子システム創造専攻 博士課程1年

顧 暁冬

1. 緒 言

情報技術は、我々の生活を支える不可欠な社会基盤になっており、多様な革新的イノベーションが我々の生活を大きく変革し、利便性など様々な果実もたらしてきた. 現在の携帯端 末を通しての動画配信など、爆発的に成長する情報化社会を支える光ファイバ通信も1960 年代のレーザの発明や低損失ガラスファイバの開発など、技術革新から生み出された1つで ある. 大容量光ファイバ通信システムの開発により、情報通信もインターネットの急速な普 及を通して、音声から、画像、動画と情報量が急速に拡大している. このように、光エレク トロニクスは、通信ネットワークや情報処理の発展を支えてきた.

光ビーム掃引(スキャナー)デバイスは、図1に示すように、ディスプレー、イメージセン サー、レーザレーダー、プリンター、光スイッチなど様々な光情報処理機器の基幹要素であ る.現在、ポリンゴンミラー(多面体ミラー)などを機械的に高速回転することで高分解能ビー ム掃引が実用デバイスとして広く使用されているものの、掃引速度が遅いことや小型化につ いて限界がある.非機械的な光ビーム掃引の取り組みとして、電気光学結晶を用いたもの、 フェーズドアレイ、位相同期レーザアレイ、フォトニック結晶レーザなどの研究が行われて きた[1-9].特に最近では、光レーザレーダー応用で、北米 DARPA による高速ビーム掃引 プロジェクト "SWEEPER"がスタートするなど、世界的にも新たな局面に入りつつある.

ビーム掃引の性能は、図2に示すように、遠方で観測したときに、いかに細かくビームを 分解して掃引できるかを示す解像点数が重要となる。解像点数は、最大偏向角とビーム拡が り角の比N(= $\theta_{max} / \theta_{div}$)で定義される。すなわち、大きなビーム偏向角とともに、小さ なビーム拡がり角が必要とされる。多くの実用システムでは、解像点数1,000以上の高解像 度ビーム掃引が必要とされるが、これまでの非機械式ビーム掃引デバイスでは、いずれも解 像点数100に満たないものばかりで技術的限界があった。

本研究では、光の群速度を遅くするスローライト導波路の巨大な構造分散を活用すること で、大きなビーム偏向角とともに小さなビーム拡がり角を両立できることを見出した.スロー ライトは、現在、光素子の小型化、光遅延回路など様々な応用の観点からも研究が進められ



図1 ビーム掃引技術の様々な応用

図2 ビーム掃引デバイスの性能指数

ている [10-19]. スローライト導波路の構造分散について着目してみよう. 図3は, スロー ライト導波路と,通常の光ファイバなどの全反射を用いた光導波路の伝搬の様子を模式的に 示している.光線幾何学で示される光の伝搬角は,導波路の屈折率差で制限されるため,通 常数度以内である.一方,全反射ではなく,1/4光学厚さの膜を周期的に形成した Bragg 反 射鏡を用いた Bragg 反射鏡導波路 [19,20] では,伝搬角を 90°(つまり伝搬方向に対して垂 直) に近いところまで大きくすることも可能である.このように大きな伝搬角でジグザグに 伝搬する光に対しては,光の伝搬方向での群速度は,自由空間に比べて大きく群速度が低下 することになる.このようなスローライト伝搬では,伝搬方向と垂直方向の光の波数ベクト ルは,導波路のコア層の厚さで決まるため,光の波長を変えると伝搬角が大きく変わる.す なわち巨大な構造分散がもたらされる.著者らはこの巨大な構造分散を用いることで高解像 度のビーム掃引が実現できることを見出した.

著者らは、上記のスローライド導波路における巨大な構造分散を利用した新たな原理に基 づくビーム掃引デバイス(図4)を提案し、そのデバイス設計と高解像ビーム掃引についてデ バイス製作と実験的検証を行ってきた [21-26].本技術は、従来のビーム掃引技術の限界を打 破し、非機械式で、小型、高解像度、高速のビーム掃引を可能とする新たな可能性を切り拓 いた.本小論では、Bragg 反射鏡導波路を用いた高解像度ビーム掃引デバイスの動作原理、 設計と素子製作、そのビーム掃引特性、およびその将来展開について述べる.





図3 Bragg 反射鏡導波路におけるスローライト伝搬 図4 提案する光ビーム掃引デバイス

2. 動作原理とデバイス設計

前節では、DBR 導波路におけるスローライトの伝搬を紹介した.本節では、この導波路 を用いたビーム掃引の動作原理について述べる.DBRの反射率は材料屈折率差と積層構造 のペア数で決まり、そのペア数の増減することで、所望の反射率を得ることが可能である. ここで、一部の伝搬光を導波路表面から放射させるため、上部 DBR のペア数は下部 DBR より少なく設定されている.図5に、伝搬光と放射光の幾何学的関係を示している.放射 される光は、導波路(屈折率 nwg)と外部(ここでは空気)の屈折率差により、スネルの法則 $(n_{air} \cdot \sin \theta = n_{wg} \cdot \sin \theta_i)$ が適用される.図5に示すように、伝搬角 θ_i は、伝搬光の 波数 κ 、導波路の遮断波長の波数 κ_c およびスローライト伝搬定数 β から決められる.これ らのパラメータを使って, 波数 κ を波長 λ に替えることで, 上部の自由空間に放射される光 の偏向角 θ は次の式で示される.以下の式は, DBR 反射鏡を完全導体で近似した近似解析 の結果であるが, 次に述べる厳密解析とよく一致することを確認している.

$$\sin\theta = n_{wg} \times \sqrt{1 - (\frac{\lambda}{\lambda_c})^2}$$
 (1)

(1)式から、導波路の遮断波長 λ c の近傍では、波長変化によって大きく偏向角 θ が変化することがわかる.

次に、フィルムモードマッチング法を用い、電磁界シミュレーションによる厳密解析を行った.図6は、Bragg反射鏡導波路に異なる波長を持つ光を入射させ、スローライトを伝搬したとき導波路表面周囲の電界振幅分布の相対強度を示している.入射光の波長は940 nm から980 nm まで変化させた.空気中の光伝搬を見ると、入射光波長の変化に伴い、放射光の 偏向角度は大きく変わることがわかる.例えば、遮断波長近傍から40 nm 波長を変化させると、50度以上のビーム掃引が可能であることがわかる.1°/nm より大きな角度分散を持つことがわかった.ここで、計算の対象とした構造での遮断波長は982 nm である.



図5 ビーム偏向の原理

図6 波長掃引によるビーム偏向の計算結果

また,図6の図中で,明確な出力光電界の平行線が確認できる.これは,出力光の高コヒー レント性による平面波としての特性を持つことを示している.コヒーレント光では,ビーム 拡がり角 θ_{dv} は,放射するビーム幅wに対して, λ /wで近似的に求めることができ,放 射ビーム幅w増加させることによって,ビーム拡がり角を小さくすることが可能である. Bragg反射鏡導波路では,上・下部反射鏡の高反射率化によって,伝搬損失が極めて小さくし, 放射するビーム幅wを増大することができる.図7に,放射ビームの拡がり角と有効伝搬 距離の関係を示す.右の軸は,異なる偏向範囲に対して,緒言に紹介したビーム掃引の性能 指数である解像点数を示している.最大偏向角が40度の場合,数ミリメートルの有効伝搬 距離が可能であれば,解像点数で1,000を超えることが可能になる.

次に図8に示すデバイス構造を設計した.図8の断面概略図のように、スローライトは左 側のレンズファイバーから導波路に結合され、伝搬することができる.この結合方式は斜め 入射結合方式と呼ばれている[19].結合効率を最適するため、結合面をドライエッチングに より形成し,8ペアのDBRを残している.計算上では,結合損失は3dB以下まで抑えるこ とが可能である.導波路の上部・下部DBRはそれぞれ28,40ペアと設計し,コアの上には 酸化狭窄層を利用して横方向の光閉じ込めを形成する.この酸化狭窄技術は同様な構造を有 する面発光レーザに広く適用されている.結果として,損失伝搬を大幅に低減することが可 能となり,長い有効伝搬距離を得ることができるようになった.



図7 ビーム拡がり角と解像点数

図8 Bragg 反射鏡導波路によるビーム掃引デバイス

3. 実験結果

前節で述べた構造設計に基づきデバイスの製作を行った.製作プロセスを図9に示す.有 機金属気相成長法(MOCVD)により,1波長厚みのGaAsを上部・下部DBR それぞれ28, 40ペアの層構造で挟んだウェハ構造を成長した.続いて,2回のリソグラフィとドライエッ チングプロセスにより,導波路メサ構造形成と光結合部形成を行った.水蒸気中で加熱する ことで選択酸化プロセスにより半導体中にAl₂O₃を形成して導波路の横方向閉じ込め構造を



図9 製作プロセス

形成した.図10に製作したデバイスの顕微鏡写真を示す.写真は,素子長1mmで12本のア レイ状に配列したものである.本デバイスは,半導体プロセスにより高密度にアレイ状に配 列できることも特徴として有しており,これは後述する光スイッチ素子への適用で大きな意 味を持つ.ビーム掃引の測定には,素子長5mm,導波路幅6µmのものを用いた.

ビーム偏向の測定は、レンズ系により遠視野像を CCD 上に投影する遠視野像測定系 (図 11)を用いた.その角度分解能は、0.004°の高解像分解能を有する.Bragg 反射鏡導波路へ の光結合は、波長可変レーザからレンズファイバを通して、光結合部から斜め入射法により 直接入射して結合した.レンズファイバの入射角、位置を精密に制御して結合損失を評価し た.理論的な結合損失は約3dB であるが、本デバイスの実測値は約10dB であった.この値は、 今後結合部分のエッチングの形状制御などで改善できるものと考えている.



図10 製作した素子の顕微鏡写真

図11 遠視野像(ビーム偏向) 測定系

図12は遠視野像の測定結果を示している.入射光の波長を 952nm から 989 nm まで変化 させている.入射光の偏光は,電界が基板と水平になる TE モードになるように設定した. 波長変化に対して連続的に 60°以上の大きなビーム偏向が得られた.図12に示すように,伝 搬方向(x軸方向)に対しては,非常に小さなビーム広がり角が得られていることがわかる. これは前述したように,導波路の低損失伝搬により有効伝搬距離が長いため,回折限界によ り狭い出射ビームが得られるためである.それと直交方向は,導波路を伝搬するビームの横 方向スポットサイズ(約5µm)で決まっている.実際の応用しステムでは,必要に応じてシ リンドリカルレンズの使用によって円形ビーム変換することも可能である.また,現在の実 験結果はデバイスの片端からの入射であるが,デバイス両端から入射することで,偏向角は 2倍,すなわち,120°(-70°~-10° and +10° to +70°)に拡大できる.

図13には、ビーム偏向角とビーム広がり角の測定値と計算値を波長に対して示している. 実験結果と計算結果がよく一致していることがわかる.ビーム広がり角は、前節の述べたよ うに、伝搬損失で決まる有効伝搬距離で律速されているが、本デバイスでは有効伝搬距離と して数 mm に及ぶことが近視野像の測定からも併せて確認している.図13から最小のビー ム広がり角0.025°,958~986nmの波長範囲28nmにわたって、広がり角0.04°の狭出射ビー ムが実現されていることがわかる.その波長範囲でのビーム偏向角41°から、解像点数とし て1,000以上が得られ、非機械式のビーム偏向としては、従来方式を10倍以上凌駕する世界 最高の高解像ビーム掃引を実現した.



図12 波長を変化に対する遠視野像の変化

このような角度分散素子を用いてのビーム 偏向技術について、他の方式との比較を図14 に示す. 通常の回折格子 [27]. VIPA (Virtually Imaged Phased Array) [28], AWG(Arrayed Waveguide Grating) [29] と本デバイスとの 比較を示している. ビーム偏向角の大きさは. 角度分散の大きさ d θ /d λ と有効波長帯域 の積で決定される。例えば、通常の回折格子 は, 角度分散値 d θ /d λ は 0.05°/nm 程度 と本提案デバイスに比べて1/10以下であり. VIPA については、有効波長帯域が 1/10程度 と小さい.結果として同じデバイス長(ビーム 幅)に対して、解像点数を比較すると、本提案 デバイスが10倍程度大きな値を有することが わかる. このように、大きな角度分散特性と 大きな有効波長帯域により、小型で世界最高 性能の高分解ビーム掃引特性がもたらされた.



図13 波長変化に対する偏向角とビーム 拡がり角





4. まとめと今後の展望

本研究では、周期構造の超高反射率ミラーから構成される低損失 Bragg 反射鏡導波路を 形成し、その巨大な構造分散を活用することで、従来の非機械式の光ビーム掃引の限界を打 破する高分解能光ビーム掃引デバイスを実現した.新規デバイスの構造提案を行い、そのビー ム掃引特性を明らかにした.従来の回折格子と比べると1桁以上大きい巨大角度分散特性と 100nmに及ぶ有効波長帯域を明らかにし、伝搬損失低減により、出射ビームの回折限界で 決まる解像点数は理論的には、数千点にも及ぶことが明らかにした.

実際に、GaAs/AlGaAs 系 Bragg 反射鏡導波路を半導体プロセス技術を駆使して、製作し、

そのビーム偏向特性を明らかにした. 偏向角60°以上におよぶ連続的なビーム偏向を実現す るとともに,最小ビーム広がり角0.025°の狭出射ビームを実現し,解像点数として 1,000を 越える超高解像ビーム掃引を達成した.これは,非機械方式のビーム掃引の解像点数として は世界最高である.現在の解像点数は,機械方式の最高性能には及ばないものの,導波路の 伝搬損失をさらに低減して長尺化 cm オーダーまで行うことで,解像点数10,000の超高解像 ビーム掃引に展開することも夢ではない.

最後に応用システムも含め、今後の展望をまとめる.

1) 巨大角度波長分散と超高解像度ビーム掃引への挑戦

超高反射率の多層膜反射鏡(Bragg 反射鏡)による低伝搬損失と巨大構造分散によるデバイ スの小型化と高解像点数の両立が可能である.これまでに確立した高精度な薄膜形成技術に よる多層膜反射鏡技術により,出力ビームの広がり角低減による解像点数の限界(10,000点) への挑戦とイメージセンサー・レーザレーダーへの応用が期待できる.

2)光通信ネットワークおける超小型光合分波器・波長選択スイッチへの展開

光波長で経路切り替えを可能とする柔軟な光通信ネットワークでは、多数の波長を分波・ 合波する光合分波回路、さらには波長空間でのスイッチングを行う波長選択スイッチが必要 とされている.本研究で実現された巨大な角度波長分散素子は、高密度のアレイ化も可能で あり、自由空間光学系との組み合わせによるスケーラビリティの優れた大規模波長数に対応 する超小型光合分波器(図14(a))・波長選択スイッチ(図14(b))への展開が期待できる.

3) 集積化と新機能創成

MEMS 技術との融合により、広帯域の波長可変面発光レーザが実現できる.既に横方向 集積によるオンチップビーム掃引光源の初期動作も実証しており超小型ビーム掃引集積光源 への展開が期待できる [30].

また、本論文では直線導波路について述べてきたが、図14(c)に示すようにリング状導波 路を形成することで、位相面がスパイラル状に振動する Vortex ビームの形成に成功してい る [31]. これは、多モード光ファイバ伝送における高速伝送やモード多重伝送などの道を切 り開くと期待される.

4) 小型レーザディスプレイへの展開

本技術は、機械方式に依存しない高解像度ビーム掃引技術を提供するもので、図14(d)に 示すように、可視光で R, G, B のレーザ光源に本技術を適用することで、非機械式の高精細 ディスプレイへの展開も期待できる [32].



図14 本研究の高解像度ビーム掃引デバイスの応用展開

謝 辞

本研究を遂行するにあたり,終始熱心なご指導を賜りました指導教官の小山二三夫教授に 深謝いたします.また,本研究室においてこの研究を進める上でお世話になった松谷晃宏博 士,坂口孝浩助教,島田敏和氏,今村明博博士(現古川電工),淵田歩博士(現三菱電機)に感 謝いたします.

参考文献

- [1] J. C. Wyant, Applied Optics, 14, pp.1057-1058 (1975).
- [2] T. Matsuda, F. Abe and H. Takahashi, Appl. Opt., 17, 878-884 (1978).
- [3] K. O. G. Varughese, and K.S.R. Krishna, Appl. Opt., 32, 1104-1108 (1993).

[4] D. A. Scrymgeour, Y. Barad, V. Gopalan, K. T. Gahagan, Q. Jia, T. E. Mitchell and J. M. Robinson, Appl. Opt., 40, 6236-6241 (2001).

- [5] K. Nakamura, J. Miyazu, M. Sasaura and K. Fujiura, Appl. Phys. Lett., 89, 131115 (2006).
- [6] Y. Kurosaka, S. Iwahashi, Y. Liang, K. Sakai, E. Miyai, W. Kunishi, D. Ohnishi and S. Noda, Nature Photonics, 4, 447-450 (2010).
- [7] P. F. McManamon, T. A. Dorschner, D. L. Corkum, L. J. Friedman, D. S. Hobbs, M. Holz, S. Liberman, H. Q. Nguyen, D. P. Resler, R. C. Sharp, and E. A. Watson, Proc.

IEEE, 84, 268-298 (1996).

- [8] J. A. Thomas, and Y. Fainman, Appl. Opt. 37, 6196-6212 (1998).
- [9] F. Xiao, W. Hu, and A. Xu, Appl. Opt. 44, 5429-5433 (2005)
- [10] R. W. Boyd, and D. J. Gauthier, Progress In Optics, 43, 497-530 (2002)
- [11] E. Podivilov, B. Sturman, A. Shumelyuk, and S. Odoulov, Phys. Rev. Lett. 91, 083902 (2003).
- [12] S. Residori, U. Bortolozzo, and J. P. Huignard, Phys. Rev. Lett. 100, 203603 (2003).
- [13] T. F. Krauss, Nature Photon. 2, 448-450 (2008).
- [14] Z. Shi, R. W. Boyd, D. J. Gauthier, and C. C. Dudley, Opt. Lett. 32, 915 (2007)
- [15] U. Bortolozzol, S. Residori, and J. Huignard, Laser Photonics Rev. 4, 483-498 (2010)
- [16] L. Thevenaz, Nature Photon. 2, 474 (2008).
- [17] T. Baba, Nature Photon. 2, 465 (2008).
- [18] T. F. Krauss, J. Phys. D: Appl. Phys. 40, 2666-2670 (2007).
- [19] G. Hirano, F. Koyama, K.Hasebe, T. Sakaguchi, N. Nishiyama, C. Caneau and C-E. Zah. OFC2007, PDP34, (2007).
- [20] P. Yeh, A. Yariv, and E. Marom, J. Opt. Soc. Am. 68, 1196-1201 (1978).
- [21] <u>X. Gu</u>, T. Shimada, and F. Koyama, Opt. Express, vol. 19, no. 23, pp. 22675-22683 (2011).
- [22] <u>X. Gu</u>, T. Shimada, A. Fuchida, A. Matsutani, A. Imamura, and F. Koyama, Appl. Phys. Lett., vol. 99, no. 21, pp. 211107-1⁻³ (2011).
- [23] X. Gu, T. Shimada, A. Fuchida, A. Matsutani, A. Imamura, and F. Koyama, Electron. Lett., vol. 48 No. 6, pp. 336-337 (2012).
- [24] M. Nakahama, <u>X. Gu</u>, T. Shimada and F. Koyama, Jpn. J. Appl. Phys. vol. 51, 040208 (2012).
- [25] <u>X. Gu</u>, T. Shimada, A. Matsutani, and F. Koyama. Opt. Express, vol. 20, no. 26, B331-338 (2012).
- [26] <u>X. Gu</u>, T. Shimada, A. Matsutani, and F. Koyama. IEEE Photon. J, Vol. 4, No. 5, pp. 1712-1719 (2012).
- [27] D. R. Wisely, Electron. Lett., 27, 520-521 (1991).
- [28] M. Shirasaki, Opt. Lett. 21, 366-368 (1996).
- [29] M. K. Smit, Electron. Lett., vol. 24, 385-386 (1988).
- [30] T. Shimada, A. Matsutani, F. Koyama, IEEE Photonics Conference 2012, TuF2 (2012).
- [31] 望月翔太,島田敏和,<u>顧暁冬</u>,松谷晃宏,小山二三夫,電子情報通信学会2013年総合 大会,C-3-11 (2013).
- [32] <u>X. Gu</u>, M. Nakahama, and F. Koyama, LDC2013, LDC3-4 (2013).